

3 残基ペプチドの合成(2回目)

1 自動合成

15.603mol スケールで、WYT, CGE の 2 配列を自動合成する。

2 脱保護

1. シリンジに、カラムを反対向きで口に当て、シールごと樹脂をシリンジに移す。
補足 続けて操作しない場合は、−20°C で保存する。
2. 脱保護試薬を表 1 の組成で作成する。
3. シリンジにテフロンニードルを設置
4. 遠沈管からカクテルを脱保護試薬を 2mL 程度まで吸う。
5. テフロンニードルの先を遠沈管に差したまま、シリンジから空気を抜く。
6. 3 時間ドラフトシェーカーに放置する。

表 1: 脱保護試薬の組成

試薬	割合 (%)	実際量 (mL)
TFA	82.5	8.25
水	5	0.5
チオアニソール	5	0.5
フェノール	5	0.5
EDT	2.5	0.25

3 ペプチド沈殿

1. 脱保護試薬が入っていた 50mL 遠沈管に、シリンジからペプチド溶液を出す。
2. 遠沈管に 15% ヘプタン-TBME 溶液で 30mL までメスアップする。
3. ボルテックス、上下攪拌で混合する。
4. −20°C で一晩放置する。
5. 沈殿が得られなかったら、少量の水を添加し、ボルテックスして 4°C で一晩放置する。
6. 沈殿が得られたら、0°C, 3000g で 10 分間遠心する。
7. 上清を捨て、蓋を開けて放置して乾燥させる。

4 凍結乾燥